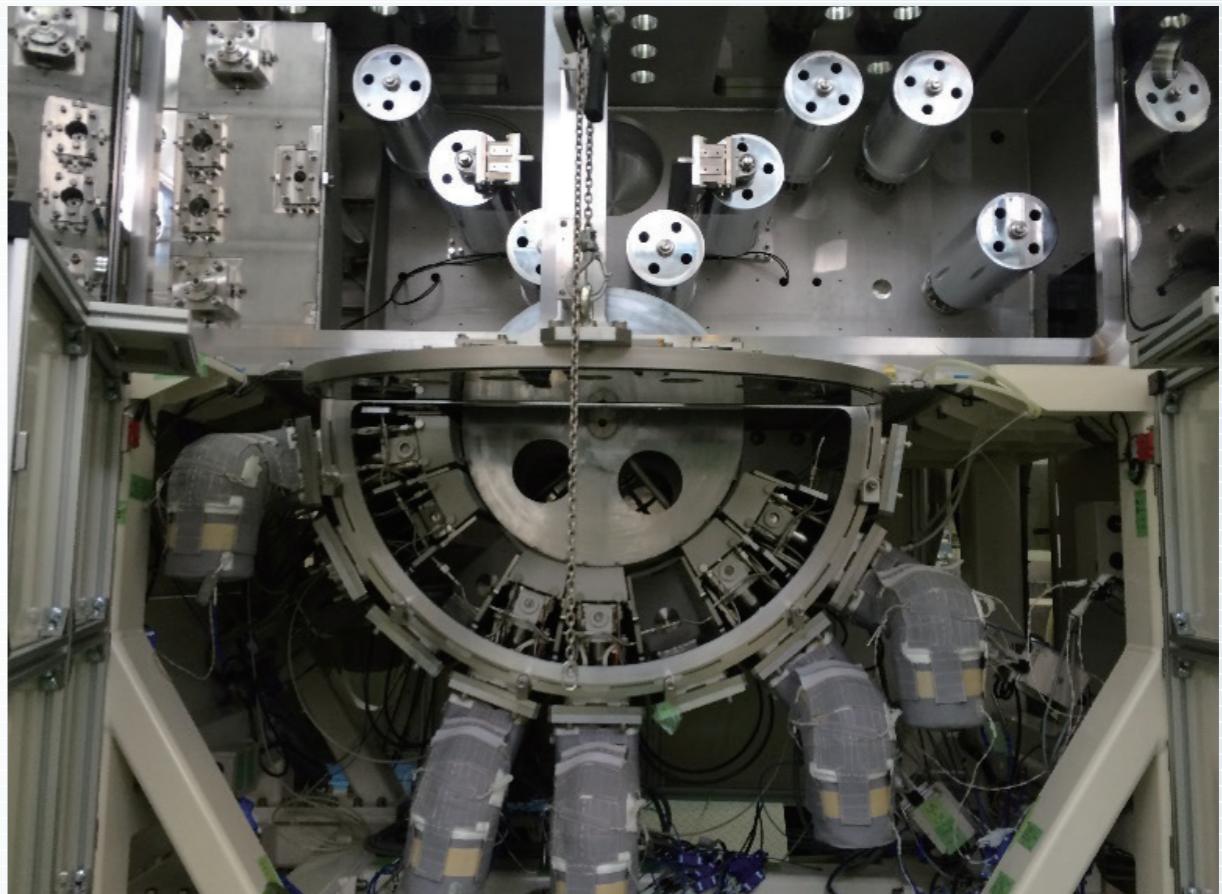
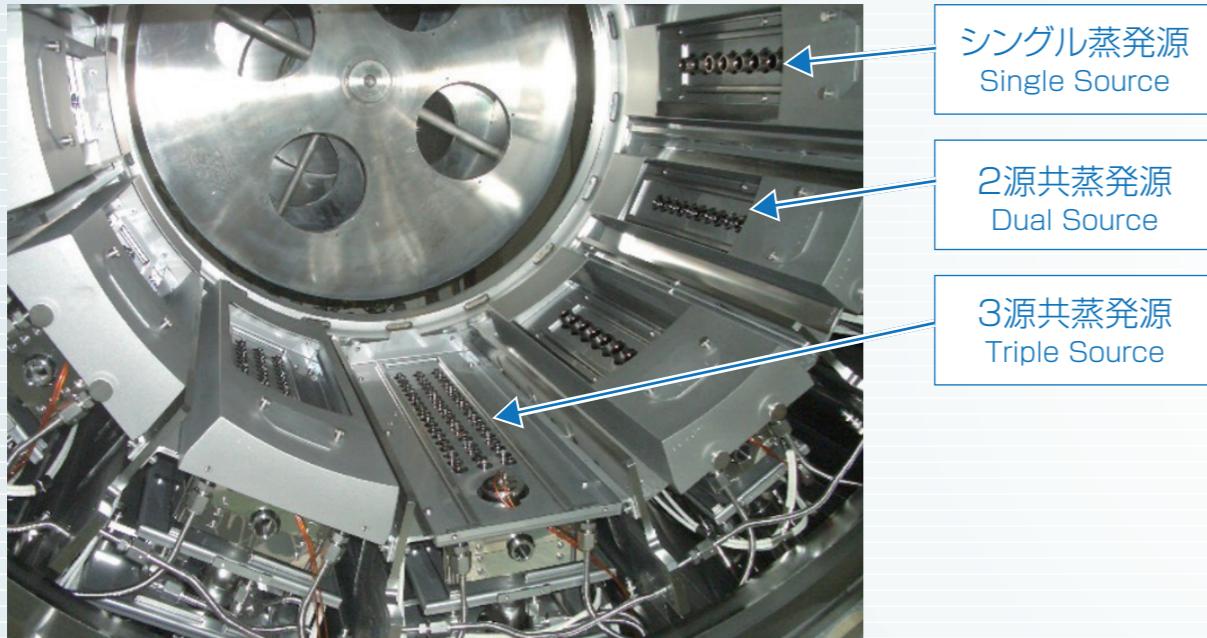


面蒸発源転用リニアソース

Linear Source converted from Planar Source

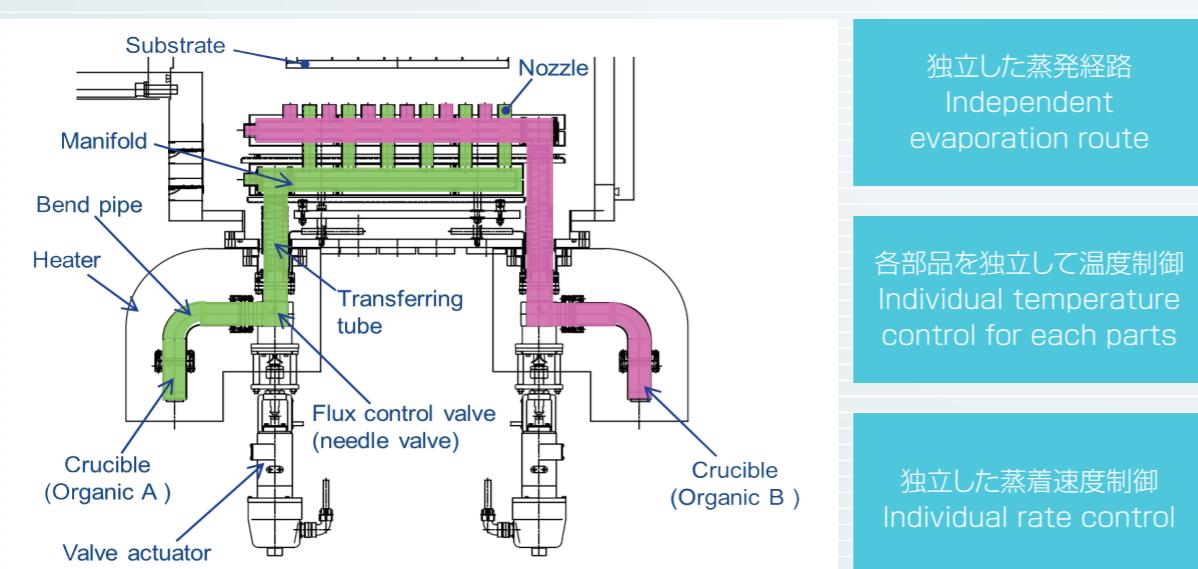
従来の静止成膜用面蒸発源技術を応用し、連続式蒸着用リニアソースを新たに開発しました。

We have developed a linear source for continuous deposition by applying planar source technology for static evaporation.



有機蒸発源構成断面図(2源共蒸着タイプ)

Concept Section Drawing of Organic Source(Dual Source type)



独立した蒸発経路
Independent evaporation route

各部品を独立して温度制御
Individual temperature control for each parts

独立した蒸着速度制御
Individual rate control

特徴 Features

- 有機蒸発源の材料交換機構の搭載 (プロセスチャンバ真空下での交換)
Equipped Crucible changing mechanism without leakage of the vacuum chamber
- 長寿命の圧力式膜厚計の搭載
Equipped Pressure type evaporation rate sensor

性能 Performance

- バレブ制御により有機材料の
材料利用効率 > 60%
Organic material utilization efficiency for
valve control > 60%
- 膜厚均一性の確保 $\leq \pm 3\%$
High thickness uniformity $\leq \pm 3\%$
- 蒸着最高使用温度 450°C
Evaporation temperature MAX450°C
- 有機3源共蒸着が可能
Up to 3 Organic Co-evaporation available